(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許出願公告番号

特公平7-104304

(24) (44)公告日 平成7年(1995)11月13日

(51) Int.Cl.⁶ 識別記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所 G01N 25/68 В С 21/47

発明の数1(全 7 頁)

(21)出願番号	特顧昭62 -145764	(71)出願人 99999999
		大阪酸素工業株式会社
(22)出顧日	昭和62年(1987) 6月11日	大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番14号
		住友生命新大阪北ビル
(65)公開番号	特開昭63-309846	(71)出願人 999999999
(43)公開日	昭和63年(1988)12月16日	西澤漫
		宮城県仙台市米ケ袋1丁目6番16号
		(72)発明者 田川 太一
審判番号	平5-306	大阪府高槻市日吉台3番町3-29
		(72)発明者 來島 貴彦
		大阪府枚方市藤阪西町 2 - 7 - 102
		(74)代理人 弁理士 湯浅 恭三 (外4名)
		審判の合議体
		審判長 安田 啓之
		審判官 志村 博
		審判官 新井 克夫
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ガス中の微量水分量測定装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】反射鏡、ヘリウム冷凍機又は液体窒素源、 その反射鏡はそのヘリウム冷凍機又は液体窒素により常 温から液体窒素温度までの温度を変えることが可能であ り、その反射鏡は、その表面にアルミニウムを蒸着し、 その上に窒化アルミの薄膜をコーティングしたシリコン ウエハーからなり、その反射鏡に向けて配置された被測 定ガス吹出しノズル、鏡面上の被測定ガスが吹きつけら れる部分に放射される集光光線又はレーザー光発射装 置、散乱光の増加を検知する検知装置を含むガス中の微 10 体中の水分が冷却された鏡面上に凝縮した時の変化を光 量水分量の測定装置。

【発明の詳細な説明】

(産業上の利用分野)

本発明は、常温より-80℃以下の低温度の露点をもつ非 疑縮性微量水分含有ガスの水分量測定装置に関する。

近年、技術のめざましい発展にともなって、微量水分量 0.5ppm以下(露点-80℃以下)のようなN₄,Ar,H₄,He等 の不活性ガスの利用が増加している。特に半導体工業に おけるエピタキシャル成長やCVDの材料ガス、キャリア ガスは、超高純度が要求されており、-80℃以下の露点 を正確に測定することが要求されるようになった。 (従来技術)

ガス中の水分量の測定としては、従来多くの手段が知ら れている。たとえば露点を測定する方法として被測定気 学的に検知する方法が古くから知られている。たとえ ば、工業計測法ハンドブック(S.51.朝倉書店)P297に は寒剤、冷凍機、電子冷却器を用いて鏡面上の反射光の 増減を光電素子で検出し、鏡面の温度を設定することに よって、露点から基本的に湿度を求める絶対測定法につ

いて、説明されている。これは、発光ダイオードや白色 光源から投射される冷却面を備えており、その表面から 反射された光は、光検知素子によって受光される。通 常、ベルチェ素子で冷却される冷却面が冷却されると、 被測定気体中から水分が冷却面に凝縮又は凝固するため その水の分子に投射した光の一部が吸収されたり、散乱 されたりすることにより、反射された光の強度は減少す る。この反射光の強度の変化を光検知素子でとらえ、そ の変化を示した時の冷却面の温度を測定することによっ て、被測定気体中の水分の露点を測定する方法が一般的 である。この反射光の変化を用い工業的により正確に、 又、連続的に測定する露点計の研究は非常に多く、特開 昭56-151347、56-154652、58-113840及び61-75235 等がある。

一方、反射光の変化を測定する方法の代わりに反射角度 と異なる角度に散乱される光の変化を測定することによ り鏡面の凝縮又は、凝固した水(氷)によって、急激に 光が散乱される結果、冷却面の温度を明確に測定すると とによって露点を測定する方法については、特開昭58-113839にも示されているが、原理的には古く1965年にRe 20 inhold Publ.Co.New Yorkより出版されたHumidityand M oistwce (Vol.1 P165) に見られる。しかし、この場合 の測定範囲も-73℃~4.9℃の間と示されていて、本発 明のような低露点の測定は、実現されていない。更に被 測定気体中の微量水分量の測定方法のうち被測定気体中 の水分が冷却された冷却面上の凝固した時の変化を光学 的に検知する方法以外の方法については、水晶発振子の 周波数の変化や水分の吸着による静電容量の変化を測定 する等の方法が実用化されているが、いずれの方法も高 度の正確度をもって-80℃以下までの露点を測定するた 30 めの技術についての記載は、見あたらない。

鏡面に被測定気体から水分を凝縮又は凝固させ、その時 に反射された光が減少する変化をとらえる露点測定法で は、被測定気体中の水分が微量になればなるほど、すな わち、露点が低くなればなるほど水の凝縮(固)量が極 度に減少する結果、正確に露点を測定することは難し い。この場合、従来の冷却された鏡面上にゆるやかに流 れる気体から極めて微量の水分が凝縮(固)する状況 は、非常にゆるやかなものであって、特に-80℃の露点 以下では、明確な反射光の変化を示さない欠点があっ た。又、10 (ppb) 以下の微量の水分の場合には、鏡面 上に徐々に水の分子が吸着し始め、その結果、急激な反 射光の変化を読み取ることは困難であった。被測定ガス をノズル (或はパイプ) 状のものから鏡面に向けて吹き つけることは有効な手段である。しかしながら、従来ほ ば正確に測定できるとされる-80℃の露点をもつガス は、ほぼ1ppmであり、-110°Cの露点では、1ppmの約1/1 000、又-136℃では更にその1/1000すなわち1pptのよう な極めて微量な水分が鏡面に凝固する温度を的確に読み 取る必要があり、そのための技術が要求されていた。

(問題を解決するための手段)

本発明の発明者は、シリコンウエハーの上にアルミニウムを蒸着し、その上に窒化アルミの薄膜をコーティングした反射鏡を使用すると、1ppm以下の水分を有するガス中の水分量を露点により測定できることを発見し、本発明に至った。

本発明は、反射鏡、ヘリウム冷凍機又は液体窒素源、その反射鏡はそのヘリウム冷凍機又は液体窒素により常温から液体窒素温度までの温度を変えることが可能であり、その反射鏡は、その表面にアルミニウムを蒸着し、その上に窒化アルミの薄膜をコーティングしたシリコンウエハーからなり、その反射鏡に向けて配置された被測定ガス吹出しノズル、鏡面上の被測定ガスが吹きつけられる部分に放射される集光光線又はレーザー光発射装置、散乱光の増加を検知する検知装置を含むガス中の微量水分量測定装置に関する。

本発明に従えば、窒素、アルゴン、水素、ヘリウム等の ガス中に含まれる水分量を、-80°C以下の露(霜)点ま で工業的に測定し得ることを可能にした。

が測定ガスを鏡面上に吹きつける前に、予め冷却する予備冷却部を設け、又この予備冷却部で冷却された被測定ガスを鏡面に向けて吹きつけることが好ましい。

本発明は、鏡面上に被測定ガスを吹きつけ、そのガス中の水分をその鏡面上に凝固させ、その凝固の状態を確認するために集光された光線又はレーザー光をその部分に 集光させ、散乱光の増加を測定し、その際の反射鏡の温度をもって露点とする。この用途のための集光された光線又はレーザー光は、市販されており公知である。

本発明の実施例の詳細を説明するために、第1図に基づき説明するが、本発明は、必ずしも第1図に示される構成に限定されるものではない。

先ず光は、光源1から、放物面鏡19によって平行光線に 集束させた後、集光レンズ2によって、できる限り鏡面 4の上に集光せしめるように入射窓3を通って照射され る。シリコンウエハーからなり、その上にアルミニウム が蒸着され、その上に窒化アルミの薄膜がコーティング されている反射鏡4の鏡は、ヘリウム冷凍機5のコール ド面に熱的に充分な接触が保持されていて、ヒーター6 及び温度調節器7とによって、その鏡面温度は、自由に 昇温したり、降下せしめたりできるよう構成されてい る。光線は該鏡面44で反射されるが、その反射光路とは 異なる角度の光路上に光検知素子8が設置されており、 該鏡面上で散乱された光が測定されるようになってい る。該鏡面4の温度は、熱電対9で測定される。 被測定気体は、200℃まで加熱できる疎水性材料から作 られたパーティクル状の異物だけを除去し得るようなフ ィルター20を経て、ガス導入口13より導入され、予冷器 14によって予め該鏡面4よりも少し高い温度に冷却され た後、ノズル10の開口部より、該鏡面4に向けて吹きつ

50 けられ、ガス放出口15よりガスは系外に放出される。こ

10

れらは、全て低温に冷却されるので、測定チャンバー は、適当な断熱(真空を含む)が必要である。

先ず該鏡面4はアルミニウムが蒸着され、その上に窒化 アルミが被覆されている。又、その表面は、できる限り 平滑に研磨され、好ましくは光源の波長λの1/4以下が 好ましい。このことは、該鏡面4での散乱光ができる限 り少なく、凝固点での僅かな水の凝固による散乱光の増 加をも的確に検知するために必要な条件である。又、光 の該鏡面への照射は、できる限り面上にて焦点が絞られ ていることが重要であって、発明者等の実験によれば、 ヘリウムーネオンレーザーのようにそれ自身集光された 光線を用いることも当然効果的に感度をよくする方法の 一つである。又、シリコンウエハーの表面は、ヘリウム ・ネオン・レーザー光をよく吸収する材料であって、反 射率からいえば決してよい表面ではないが、シリコンウ エハーの表面平滑度は、極めて髙く、本発明考案の実験 によれば-120℃近い露点をも測定することが可能であ った。このことから考えると、反射率がよいことが絶対 的な条件ではない。-80℃以下までの非常に微量の水分 を霜点で測定するのに有効な方法としては、集光された 20 光を該鏡面4の、被測定ガスがノズル10で吹きつけられ る箇所に向けて照射することが絶対条件であり、発明者 等の実験によれば、光の入射角について種々の条件にお いて測定した結果、該鏡面4に垂直に近いほど、散放光 の急激な変化を読み取るのに感度がよいことがわかっ た。光源に発光ダイオードを用いた結果では、第4図に 示すように該鏡面4に垂直に近いほどよく、このこと は、垂直に近いほど、該鏡面4上に、よりよく集光され て照射されている結果であることを示している。この入 射角度は、60°以内が好ましく、特に10°以内がよいと とがわかった。

更に、微量の水分の測定を可能とするには、サンプリン グ配管のヒーターによる加熱が重要であり、特にガスと 共に流れてくるパーティクルを除去し得るフィルターと 共に200℃近くまで加熱し、常に系内のサンプリング等 を吸着水分の少ない状況に保持することも、微量な水分 量を露(霜)点法により正確に測定する上で重要である ことは云うまでもない。

(実施例1)

第1図に示した構成によって、液体窒素の蒸発ガスを被 測定気体としてノズル10より、鏡面4に供給し、放物面 鏡19、集光レンズ2によって可能な限り集光された発光 ダイオード1の光源から、鏡面4に投光し、その散乱光 を光検知素子8でとらえる。そこで、小型ヘリウム冷凍 機5によって鏡面4を徐々に冷却していくと、鏡面4に 被測定気体中の水分が凝固し、光検知素子8に受光した 散乱光の強さが増加した。この時の鏡面4の温度を熱電 対9で測定すると-118℃であった。すなわち、この被 測定気体の露点は-118℃であり、従来、測定不可能で

検知素子8の出力との関係を第3図aに示した。なおこ の場合、鏡面として、シリコンウエハーにアルミニウム を蒸着し、その上に窒化アルミを被覆したものを用い可 能な限り集光された発光ダイオード光線の鏡面への入射 角は垂直に対して5°とした。

(実施例2)

実施例1の構成において、発光ダイオード1、放物面鏡 19を測定チャンバ12の中に設置して実験を行なった。こ の場合測点チャンバ内の温度は、変化するので、発光ダ イオード1の輝度が変化し、光検知素子8で検知する散 乱光を正確に測定する上で妨げとなることがある。そこ で、小型ヘリウム冷凍機5と発光ダイオード1を適当な 銅線22を用いて熱接触させ、ヒーター23による温度コン トロールにより発光ダイオード1の温度を-20℃の一定 温度に保持し、温度変化による発光ダイオード1の輝度 の変化を防止した(第2図)。この構成を用いて実施例 1と同様な実験を行なった結果、実験例1以上に高い感 度をもって測定された。第3図bには、鏡面4と光検知 素子8の出力との関係が示されている。 すなわち第2図 に示した構成によっても-80℃以下の露点が正確に測定 し得ることを確認した。

(比較例1)

実施例1と構成において、鏡面4を銅の表面の面精度を λ (測定波長λ = 10.6μ m) の精度に研磨し、実施例1 と同様に鏡面に可能な限り集光された発光ダイオード光 線を投光すると、被測定気体中の水分が凝固していない 状態においても散乱光の強さは、実施例1の場合よりも 強く、又凝固した場合にも光検知素子8の出力は変化し なかった。冷却面である銅の表面の面精度をいろいろと 30 変えて同様な実験を行なった結果、面精度は、λ/4(測 定波長λ = 10.6μm) 以上においては露点 - 120℃のよ うな極微量の水分を含む気体の露点は測定できなかっ た。面精度を λ ($\lambda = 10.6 \mu$ m) から $\lambda/4$ まで変えた時 の光検知素子8の出力の変化を第5図に示した。

(比較例2)

実施例1の構成において、鏡面に投光する光源を可能な 限り集光するための放物面鏡19と集光レンズ2を取り外 し、実施例1と同様の実験を行なった。

発光ダイオードから鏡面4上で集光させない場合には、 - 78℃の露点までは測定できるが、それ以下の水分量を 含む気体では散乱光の増加を検知することはできなかっ た。被測定気体の露点が-120℃、-78℃の場合の結果 を第6図、第7図に示した。すなわち-80℃以下の低露 点の測定には、鏡面4に投光するための光線は可能な限 り集光する必要がある。

(比較例3)

実施例1の構成において、光検知素子を反射光の光路上 に設置し、実施例1と同様の実験を行なった。鏡面に投 射される光線は、ヘリウムーネオンレーザーと可能な限 あった低露点が測定できた。この時の鏡面4の温度と光 50 り集光された発光ダイオード光線を用いた。この場合光 源の種類にかかわらず、反射光の強さの減少は、微量で あった。とれらの結果を第8図、第9図に示したが、と の結果から反射光の減少を測定して露(霜)点を測定す る場合は、-75℃以下の露(霜)点は測定できないこと を示している。

(比較例4)

鏡面に被測定気体から凝縮又は凝固する水分を付着さ せ、それを光学的に検知する方法以外の方法として酸化 アルミ薄膜に金を蒸着したセンサーの静電容量の変化に よって、ガス中の水分量を測定する方法がある。これは 10 2 〔ppm〕以上の水分量測定方法としてJIS-K0226に示 される方法であるが、0℃~-90℃の露点をもつ窒素ガ スを測定したが、-80℃以下では、静電容量の変化は、 見られなかった。

第10図に静電容量式露点計の出力と本発明による水分測 定装置の光検知素子の出力との比較を示した。

(発明の効果)

以上、詳細に説明したように、被測定ガスを鏡面上に吹 きつける前に予め冷却する予備冷却部を設けて、又、と の予備冷却された被測定ガスを鏡面に向けて吹出す吹出 しノズルを備え、かつ、鏡面に投光する光源として可能 な限り集光した光線を用い、鏡面に凝縮又は、凝固する 水分の状況をその散乱光で検知することにより、常温よ り、-80℃以下の低露点ガス中の水分量を電気的にかつ 正確に測定することが可能となった。

本発明の実施態様は次の通りである。

- (1) 常温から液体窒素温度までの温度を変えることが 可能なシリコンウエハーからなる反射鏡、その鏡面にア ルミニウムを蒸着し、その上に窒化アルミの薄膜コーテ ィングし、その反射鏡に向けて配置された被測定ガス吹 30 11……冷凍機用圧縮機、12……測定チャンバ 出しノズル、鏡面上の被測定ガスが吹きつけられる部分 に放射される集光光線又はレーザー光発射装置、散乱光 の急激な増加を検知する検知装置を含むガス中の微量水 分量の測定装置。
 - (2) 冷却源が液体窒素等の低温液化ガスを用いること を特徴とする上記第1項に記載の測定装置。
 - (3)冷却源が液体窒素と電子冷凍装置とを組み合わせ たことを特徴とする上記第1項に記載の測定装置。

- * (4) 冷却源が小型ヘリウム冷凍機であることを特徴と する上記第1項に記載の測定装置。
 - (5) 鏡面に光を投射する光源が、発光ダイオードであ ることを特徴とする上記第1項に記載の測定装置。
 - (6) 鏡面に光を投射する入射角が垂直に対して、60° 以内であることを特徴とする上記第1項に記載の測定装
 - (7)被測定ガスの入口に加熱された疎水性フィルタを 備えたことを特徴とする上記第1項に記載の測定装置。
- (8)鏡面に窒化チタン等の薄膜をコーティングした上 記第1項に記載の測定装置。

【図面の簡単な説明】

第1図及び第2図は本発明方法を実施するための装置の 概略図:

第3図は鏡面温度と光検知素子出力との関係を示すグラ フ:

第4図は鏡面に対する入射角と光検知光素子出力との関 係を示すグラフ;

第5図は結露面の面精度と無結露時の光検知素子出力と 20 の関係を示すグラフ:

第6~9図は鏡面温度と光検知素子出力との関係を示す グラフ: そして

第10図は静電容量式露点計の出力と水分測定装置の光検 知素子の出力との関係を示すグラフである。

1 ……光源、2 …… 集光レンズ

3……入射窓、4……鏡面

5……小型ヘリウム冷凍機、6……ヒーター

7……温度調節器、8……光検知素子

9……熱電対、10……ノズル

13……ガス導入口、14……ガス予冷器

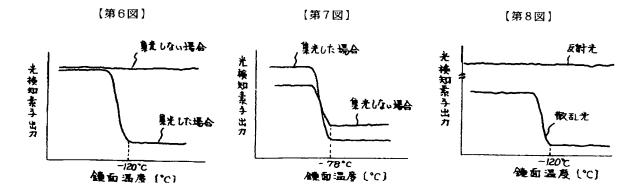
15……ガス放出口、16……ガス予冷器用ヒーター

17……ガス予冷器用温度調節器、18……ガス予冷器用熱

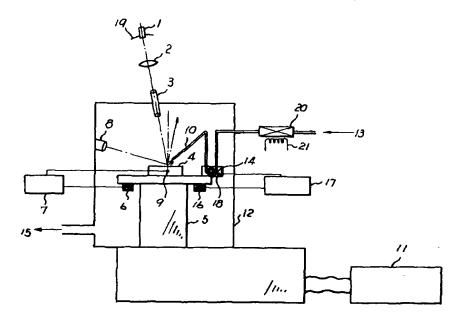
19……放物面鏡、20……フィルター

21……フィルター加熱ヒーター、22……銅線

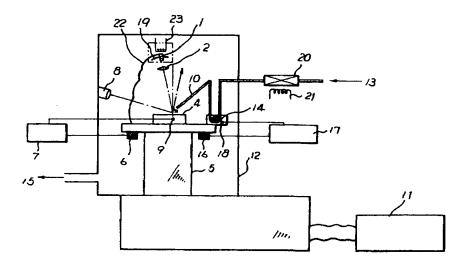
23……ヒーター

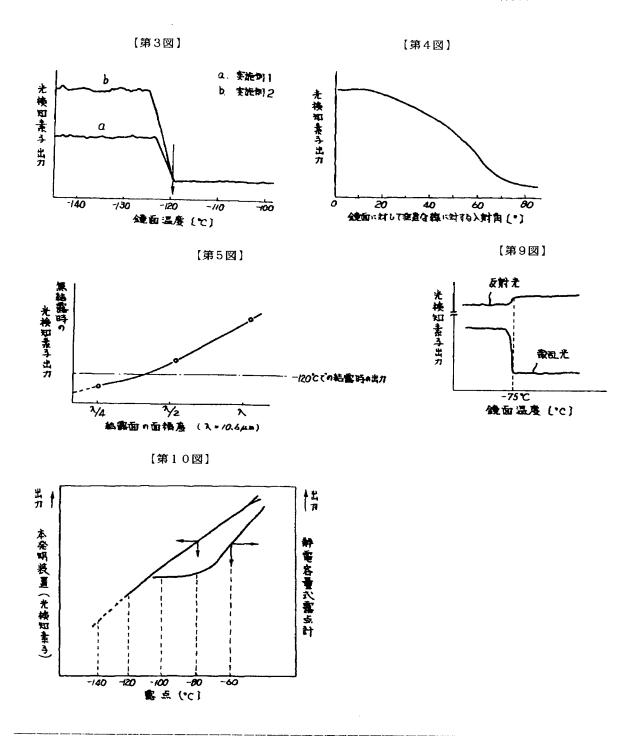


【第1図】



【第2図】





フロントページの続き

(72) 発明者 西澤 潤一 宮城県仙台市米ヶ袋1丁目6番16号

(56)参考文献 特開 昭61-124858 (JP, A)

特開 昭54-63795 (JP. A)

特開 昭60-155951 (JP, A)

特開 昭61-173141 (JP, A)

特開 昭60~93353(JP, A)

特開 昭61-124860 (JP, A)

実開 昭57-108144 (JP, U)

実公 昭36-25899(JP, Y1)

Mark Staff Hough to the

